ILC-TPCのための高開口率 GEM 型ゲート装置の開発

総合研究大学院大学

The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI) 小川智久⁰ ogawat@post.kek.jp

2017年(平成 29年)2月6日

1 はじめに

国際リニアコライダー (International Linear Collider: ILC)計画は、全長約 30 km の直線型加速器により電 子,陽電子(素粒子)を加速衝突させ,現在達成可能な 最高エネルギーで宇宙創成1兆分の1秒後を作り出す実 験計画である。時間と空間、物質と力の統一的理解のた め,標準理論を超える新物理を明らかにし,どのように 宇宙が生まれ、物質が生まれたのかという宇宙創生の謎 に迫るものである。ILC の加速器に関する技術設計報告 書(Technical Design Report: TDR [1])および測定 器に関する詳細基本設計書(Detailed Baseline Design: DBD [2]) がすでに 2012 年に発表されており, 2016 年 現在,更に詳細な検討が文部科学省において有識者会議 により進んでいる。各国の研究者によって加速器および 検出器の最終設計も行なわれており, ILC 実現へ向けた 技術検討は最終段階に来ている。今回、私自身が関わっ ている ILC-TPC の研究開発について研究紹介の機会を いただけたので、ILC-TPCの最重要課題の1つである GEM 型ゲート装置の開発に関する研究に焦点を当てて 紹介を行いたいと思う。(ILC の物理 [3],他検出器 [4] に関しては過去に高エネルギーニュースに掲載された研 究紹介を見てください。また ILC のための TPC として 書かれた研究紹介に [5] があります。)

1.1 Time Projection Chamber: TPC

TPC は密閉容器内にアルゴン,ネオンなどの単原子 分子ガスを主成分とした混合ガス封入し,荷電粒子の通 過による電離過程を利用し2次元の平面情報と1次元 の時間情報により3次元の飛跡を再構成可能とする測定 器である(図1)。1985年に David R. Nygren がその 原理[6]を提案してから,特に TPC が持つ特徴のため に,コライダー実験に用いられてきている。技術の発展 とともに TPC 自体の改良も進み,現代の多くの素粒子

⁰LC-TPC 日本グループを代表して

実験でも利用されている。TPC は物理からの要求に対 して十分な運動量分解能を持つ。また連続トラッキング を行なうので多数のハドロンジェットの事象においても 高い飛跡認識能力を持つ。また崩壊点検出器を越えて飛 ぶ長寿命中性粒子,検出器内層でカールする低運動量粒 子の識別など,様々な事象に対して対応可能である。容 器内はガスで満たされているので低物質量である一方, わずかなエネルギー損失から粒子識別も可能とする。こ れらの特徴により,ILC実験用の提案検出器の1つであ る ILD (アジア・ヨーロッパ間で共同設計中の測定器名 称 International Large Detector)においても中央飛跡 検出器として採用されている。



図 1: TPC の模式図。コライダー実験では衝突点を取 り囲むように設置される。平行に配した電場,磁場によ り電離電子の横拡散を抑えながら端部へドリフトさせ増 幅および読み出しを行う。

1.2 ILC のための TPC とその目標性能

ILC 実験では基本粒子レベルで生成事象の再構成を行う。ILC の目的の1つであるヒッグスセクターを含む電 弱相互作用過程の精密測定には、W および Z 粒子の不 変質量が分離可能なほどのジェットエネルギー分解能が

必要となる。これを実現するためにはジェット中の粒子 を分離し、各々に対してエネルギー分解能の良い検出器 の情報を用いる必要がある (Particle Flow Analysis [3])。よって ILC の中央飛跡検出器には、多数のジェット を含む事象においても荷電粒子を飛跡検出器後段に設 置されるカロリメータ内の粒子クラスタと、重複なしで 一対一対応を実現させるための高い飛跡分離能力、反跳 質量法によるヒッグス粒子の質量の高精度測定のための 高い運動量分解能が要求される。とりわけ運動量分解能 に関して言えば, ILC が目指す物理からの要求として $\sigma(1/p_t) = 2 \times 10^{-5} [\text{GeV}^{-1}]$ が具体的に示されており (これは内外層のシリコントラッカーの情報も用いた場 合である。TPC 単独では 1 × 10⁻⁴ [GeV⁻¹]), これは 過去の電子陽電子衝突実験(LEP),また現在行われて いる大型ハドロン衝突実験(LHC)の運動量分解能より もおよそ1桁良い精度となる。次式 [8] のように運動量 分解能は荷電粒子が通った位置の測定精度に依存するの で,精度良い運動量分解能を得るためには荷電粒子によ る電離が発生した位置を精度よく測定する必要がある。

$$\sigma_{p_t} / p_t^2 = \frac{\sigma_{r\phi}}{0.3BL^2} \sqrt{\frac{720}{N+4}}$$
(1)

上式において p_t , σ_{p_t} , $\sigma_{r\phi}$ はそれぞれ荷電粒子横方向運 動量,測定器の横方向運動量分解能と位置分解能を示 す, N は測定点の数, B[T] および L[m] は磁場の強さ と測定器の飛跡検出長である(ここでは多重散乱の寄与 は無視している)。ILC-TPC に要求される運動量分解 能,また現在考えられている検出器サイズ,加えられる 磁場などを考えた場合,ILC-TPC に要求される位置分 解能 $\sigma_{r\phi}$ は 2.2 m の最大ドリフト距離に渡って 100 μ m 以下にする必要がある。

1.3 T2K ガス

TPC の位置分解能は充填するガスによって大きく左 右される。ドリフト距離の長い大型 TPC では、荷電粒 子の通過による電子の電離からアノード面での読み出し まで、信号電子がドリフトしている間はガス中の分子と 衝突を繰り返すので、縦および横方向に拡散の影響を受 ける。特に横方向の拡散は結果として初期電離の発生位 置をぼやかし、位置分解能を悪化させてしまう。しかし ながら、横方向の拡散に関しては次式のように磁場の効 果が入ることが知られており、信号電子の横拡散の影響 を抑制することができる。横方向拡散定数 C_d は、

$$C_d(B,E) = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}C_d(0,E)$$
 (2)

 ω はサイクロトロン振動数 ($\omega = eB/m, e, B, m$ は素電 荷,磁場,電子質量), τ は電子が原子と衝突して次の分 子と衝突するまでの平均自由時間 ($\tau = m\bar{v}/eE, \bar{v}, E$ は 電子のドリフト速度, 電場)を表す。電場と磁場が平行 にかけられる TPC では, 磁場によるローレンツ力が信 号電子に働き,進行方向に対して磁場に巻きつく形で横 拡散が抑えられながら移動する。高い位置分解能が求め られる ILC-TPC では高磁場で横拡散が小さくなるガス が必要とされ,磁場中で横拡散が小さいことが知られる CF₄,ペニング効果¹によりガス増幅率を増やせると期 待できる iC₄H₁₀ が混合された Ar ベースガス(T2K ガ ス², $\omega\tau \sim 10(3.5 \text{ T})$)が現在のところ候補となってい る。T2K ガスの特徴を図 2 に示す。3.5 T の磁場下にお いて,ドリフト速度が最大付近で横拡散は 30 μ m/ \sqrt{cm} 程度となる。



図 2: Magbolts [7] で計算された T2K ガス中での電子 のドリフト速度と拡散定数の電場依存について。

1.4 陽イオンの影響とゲート装置の必要性

TPC にはその開発当初から、荷電粒子による電離お よび電子増幅で生じる陽イオン群がドリフト領域の電 場を乱し、測定される3次元飛跡を歪ませる古典的な 問題がある。よってTPCを実験に使う場合はその実験 環境に関しても考慮する必要がある。ILC実験の場合 には電子、陽電子ビームの時間構造に注意しなければ ならない。例えばビームの制動放射による大量の電子陽 電子対バックグラウンドが考えられ、これら荷電粒子が ガス中を通過すると電離によりドリフト領域中に電子

¹混合ガス中で一方の分子 A が励起状態であり,A の準安定準位よりも電離ポテンシャルの低い分子 B に衝突し B が電離をおこす効果。 $A^X + B \rightarrow A + B^+ + e^-$ 。Ar の準安定励起状態はおよそ 11.6eV に対し,iC₄H₁₀の電離ポテンシャルは 10.8eV

²T2K ガスの成分比は Ar: CF₄: iC₄H₁₀ = 95:3:2 である。横 拡散を抑えるためには上記の $\omega \tau$ が大きいガスであれば良い。 ω は B の大きさで決まるので, τ が大きいガスが望まれる。 $\tau \propto l$ (平均自由 行程) であり,この値は分子との断面積に反比例する。電子の CF₄ 分 子との最大断面積は Ar 分子との断面積が大きくなる前にあるので, 電子を Ar 分子との断面積最小付近に留まらせることができる。よっ て τ を一般的なガスよりも大きくすることができる [13]。

陽イオン対が生成される(1次陽イオン)。アノード面 に到達してくる信号電子は端部検出器においてガス増 幅され、この過程でも大量の陽イオンが生成され (2次 陽イオン),電場に沿ってドリフト領域に逆流していく (Ion Back Flow: IBF)。陽イオンのドリフト速度は電 子の $\mathcal{O}(10^{-4}) \sim \mathcal{O}(10^{-3})$ 程度と非常に遅く, Ar イオ ンの場合, 300 K でその易動度は 1.6 cm²/(V·sec) 程 度であり、ドリフト電場 230 V/cm の設定ではドリフ ト速度~370 cm/sec 程度となる(T2K ガス中には Ar イオンと iC₄H₁₀ によるイオン交換のため iC₄H₁₀ イオ ンが存在していると考えらる。その易動度もおおよそ 1.6 cm²/(V·sec) 程度である [9])。設計上 ILC のビー ム繰り返し周波数は5 Hz と設定されており, 200 msec 毎に1次陽イオン群が生成されると想定できる。この1 次陽イオン群は, TPC のドリフト領域中に円筒状に重 なり合って、概ね3個存在することが予想される(4つ 目が生成される頃には1つ目は中央カソードに吸収され る)。生成される2次陽イオンは1個の信号電子に増幅 部でのガス増幅率を掛けたものになる。設計上 ILC の 1 バンチトレイン (0.73 msec) 中には 1312 バンチある ので,厚さ 0.5 cm 程度の非常に高密度な円板状の陽イ オン群が、1次陽イオン群同様、継続的に3個存在する と考えられる。その概略図を図3で表す。これまでに



with Gate device

図 3: TPC ドリフト領域中における 2 次陽イオン群の 分布と信号電子のドリフトに与える影響。

LC-TPC 日本グループは,ILC 環境下で生成されるこ れら円筒状1次陽イオン群,および円板状2次陽イオン 群の位置分解能への影響についてシミュレーション計算 を行ってきた。その結果1次陽イオン群は位置分解能の 悪化は無視できるほど小さいが,2次陽イオン群による 位置分解能の悪化はTPC の最内層ではおおよそ 60 µm に達し,求められる性能に対して無視できない影響を及 ぼすことが示された (IBF=3 と仮定³)。と同時に,陽イ 221

オン遮蔽効率の良いゲート装置を使用すれば,十分に2 次陽イオン群の効果を打ち消すことが可能であることも 示されている (図 4)。



	ゲート装置なし	ゲート装置あり
1次陽イオン	$8.5 \ \mu { m m}$	$8.5 \ \mu { m m}$
2次陽イオン	$60.0~\mu{ m m}$	$0.01~\mu{ m m}$
合計	$70 \ \mu m$	$8.5 \ \mu { m m}$

図 4: 円板状の2次陽イオン群による飛跡歪みの影響予 想図と,生成陽イオン群による位置分解能への影響。Ion Back Flow=3と仮定しての評価。

1.5 GEM 型ゲート装置

LEP および LHC 実験などの検出器において、ワ イヤーチェンバ (Multi Wire Proportional Chamber: MWPC)が用いられた大型のTPCでは、ドリフト電場 を形成するフィールドワイヤに、あるいは隣接するワイ ヤ間に電位差を与えて陽イオンの吸収を行っていた (一 種の陽イオンゲート)。ILD-TPC では増幅機構にマイク ロパターンガス検出器 (Micro Pattern Gaseous Detector: MPGD) を用いる設計のため、多数のワイヤを検 出器端部に張る構造は、ワイヤを張るための十分な張力 が必要となり、現在の MPGD を用いた検出器の構造に 合わず、その工学的設計を見直す必要が出てくる。また E×Bの影響による位置分解能悪化も懸念される。そ んな中,2006年にガス電子増幅器 (Gas Electron Multiplier: GEM) の発明者でもある F. Sauli によって GEM を用いたゲート機構が提案された。 GEM はこれまで ガス増幅装置としてのみ認識されていたが、数V程度 の低電圧で使用することにより,陽イオン阻止膜として 使える可能性を示した [10]。陽イオンは電子に比べて十 分に重いため拡散が少なく電気力線に沿って運動する。

³Ion Back Flow(IBF)=3 とは電子が1個入った場合に3個陽イ オンが戻ってくるという定義。これは例えばガスゲイン 3000, 陽イ

オン阻止率 10⁻³ と想定することと等しい。しかしながら 10⁻³ という値は 3 段 GEM や Micromegas を用いて,ドリフト電場を十分に弱くした場合に達成可能な値であり,2 段 GEM の場合では数%から 10%のレベルである。この場合上記の歪みは 100 倍近くになる可能性がある。この点も陽イオンゲートが必要となる大きな理由である。

GEM に数 V 程度の逆電圧を印加するだけで,ほぼ陽イ オンを GEM 表面に吸収することができるとされる。前 述の通り ILC-TPC 環境下では強磁場が加わり電子の拡 散を抑える必要がある。一方で通常の GEM の開口率は せいぜい 30 %程度である。問題となるのは磁場に巻き つく形で横拡散が抑えられている信号電子が,ドリフト 領域に設置される GEM 型ゲートを透過し,要求される 位置分解を達成し得る程の信号を確保できるかどうかで ある。

2 これまでの研究開発

リニアコライダーのための TPC の開発研究は LC-TPC グループと呼ばれる国際コラボレーションの下で 進められている。LC-TPC グループ内で,日本グループ は陽イオンゲート装置の開発を任されている。ILC 実験 において, IBF の問題を防ぐための陽イオンゲート装置 が要求される性能を満たすことは,ILC 実験の主飛跡検 出器として TPC が成立するかどうかを左右する最重要 課題の1つとなっている。ここでは日本グループが行っ てきた「これまで」の陽イオンゲート装置の研究開発に ついて紹介する。

2.1 GEM 型ゲートプロトタイプ

2007年頃から日本グループは、有限要素法による電場 計算と電子の輸送シミュレーション⁴を行いながら GEM 型ゲートのモデルの検討を始めた。GEM 穴の直径を広げ 開口率をあげた方が、電子が GEM 穴に入りやすくなる ので,大幅に電子透過率は上昇する。開口率を上げるだ けでなく, GEM の厚さを薄くした場合には, GEM 穴の 側面に近い場所の電場が強くなり、電気力線は GEM 穴 内に向かう向きに作られるので、GEM 穴の側面やGEM の表面に到達してしまう電子を減らすこともできる。例 えば標準的な GEM のモデルで,絶縁体部を 50 μm から 25 μm に薄くした場合, 電子透過率をおおよそ 50%回 復させることができる。導体部も同様に薄くした場合 においても,GEM 導体部側面に帰着する電気力線を減 らせるので,電子透過率を回復させることができる。以 上のような結果を踏まえ、企業に協力してもらい、標準 GEM モデルから開口率を上げ、格段に薄い GEM サン プルを作成した(図5左は穴径90 µm, 絶縁部14 µm, 導体部 2 μm, ピッチ 140 μm の写真)。この初期サンプ ルの性能評価のため(実際のところ,最大の目的は測定 値がシミュレーションを再現するかどうかの確認であっ た), KEK の低温工学センターに設置されている超伝 導ソレノイドマグネットを用い, T2K ガス, 1 T の高

⁴当時は Maxwell 3D と Garfield8 を利用



図 5: 初期の薄い GEM 型ゲートサンプルの拡大図とマ グネットを用いた電子透過率測定。GEM 絶縁部の厚さ はほぼ製造限界の 14 μm である。

磁場中で電子透過率の測定を行った (図 5 右)。 1 T の 磁場下において、5 V を印可しゲートを開いた状態での 電子透過率は 60 %程度となり、シミュレーションを再 現するものとなった。他のサンプルも同様におおよそシ ミュレーションを再現するものとなった (図 6)。しかし ながら、電子透過率 60 %という値は、荷電粒子の通過 によって生成された電離電子が 60 %に減少することで あり、後述する位置分解能式より分解能が約 30 %劣化 するということを意味する。日本グループはこの問題を 解決するために、さらに開口率を上げるなどの GEM 型 ゲートのモデルの再検討が必要になった。



図 6: GEM 型ゲートプロトタイプを用いて行われた電 子透過率測定の結果。数 V の電圧供給で最大透過率は 開口率と同程度の 60 %前後となる。

2.2 要求される電子透過率

日本グループが用いている TPC 端部検出器は 100 µm 厚の2層の増幅 GEM で構成されている。GEM 型ゲー トのモデルの検討と同時並行で、日本グループは2層の 増幅 GEM からなる端部検出器だけでどれほどの位置分 解能を得ることができるか、また ILC-TPC として要求 される性能を満たすことができるのかどうかを調べるた めに、数回に亘りドイツ・DESY 研究所で電子ビームを 用いた試験を行ってきた。 ILC-TPC 用の測定器候補の性能を確かめるためには 高磁場下で高エネルギー電子ビームが使える環境が必要 であり, DESY 研究所にはこの TPC の性能試験のため に必要とされる大型プロトタイプモジュール(LP)と 超伝導ソレノイドマグネット(PCMAG),また共通の 読み出しエレクトロニクスが設備されている。LC-TPC 内の各グループは共通の環境を使って,位置分解能等の 基本性能の実証試験を行っている。

TPC の位置分解能の長距離ドリフトでの漸近的な表 現式はよく知られており, 簡易的な場合では以下のよう な2つの項で表現される⁵。

$$\sigma_{r\phi}(Z) = \sqrt{\sigma_0^2 + \frac{C_d^2}{N_{eff}} \cdot Z}$$
(3)

 $\sigma_{r\phi}$ は方位角 ($r\phi$) 方向における位置分解能, 第1項 σ_0 は ドリフト距離に依らない定数項。C_dは拡散定数, N_{eff} は測定に寄与する有効電子数, Z はドリフト距離を表 す。本来ならば実機環境である 3.5 T という高磁場での 位置分解能を評価したいが、それに合う実験環境はま だ整備されてないので、実際にはこれらのパラメータを 1T中での実験より評価し、3.5Tに外挿して位置分解 能を得ることになる。第2項はドリフト距離に比例する パラメータであるので,入射電子ビーム位置を変更し, 電子をドリフトさせる距離を変えて距離依存の測定を行 い決定するものである。図7で示すように,2010年に 行われたビーム試験において、2層の増幅 GEM で構成 される TPC 端部検出器の電子ビームを用いた実験結果 から, GEM 型ゲートが搭載されない場合では, 2.2 m でおおよそ $\sigma_{r\phi}(\sigma_X) = 85 \ \mu m$ 程度であり、100 μm 以下 の位置分解能が達成されている。電子透過率の観点から 見ると,100 μm 以下を満たすには 80 %程度の透過率 が必要になってくることも示される。

2.3 高開口率 GEM 型ゲートの開発

増幅 GEM だけを搭載した TPC 端部検出器の位置分 解能の結果より,80 %程度の電子透過率が要求される ことが示された。また初期サンプルを用いた測定より, T2K ガスを用いた高磁場中では,透過率は開口率と同程 度となることも示されている。以上のことから,佐賀大 学を中心に企業(フジクラ)と協力して新しい GEM 型 ゲートのモデルの再検討を行った。目標開口率は80 %程 度であるが,隣り合う穴のピッチが短すぎると技術的に 難しくなってくる。再度シミュレーションを用いて検討 したところ [11],ピッチ 300 μm 程度であれば,依然と



図 7: 電子ビーム試験データに基づいて外挿された 3.5 T での位置分解能(ゲートなしの端部検出器)。

して-10 V 程度で $O(10^{-4})$ の陽イオン阻止率が得られ ることが示された。一方で図 8 に示すように,従来の GEM のような丸穴ホールでは,リム幅を狭くしていっ ても目標開口率には届かないことがわかったので,目標 開口率を満たすために六角形のハニカム構造を取るよう な形となった (図 8)。こうして作成された,高開口率の



図 8: 円構造, ハニカム構造による到達可能な幾何学的 開口率の違い。円構造では 75 %程度が限界となる。

試作 GEM 型ゲートの拡大写真を図 9, リムの断面と実 際の検出器サイズのモジュールを図 10 に示す (穴の内接 円の直径 304 µm, ピッチ 335 µm 光学開口率 82.3 %)。 図 10 右において何も写っていなように見えるところが, 実際に GEM 穴が開けられている有感領域である。この GEM 型ゲートの性能を確かめるため、 $10 \times 10 \text{ cm}^2$ の 試作品を作成し再度 KEK のマグネットを用いて高磁場 下で測定した電子透過率の結果を図 11 に示す。青の点, 実線はそれぞれ電子透過率の実際の測定値、モデルを用 いたシミュレーション⁶の結果を表す。0 T においてはシ ミュレーションは測定を再現している。

橙色の点は1T の磁場中で測った電子透過率である。Vgate =3 V前後 で透過率82%前後になる事が示されるている。同様に 橙色の実線は1T下でのシミュレーションの結果を表し ている。現在のところ高磁場下でのシミュレーションは ⁶ここで用いているソフトウェアは、ANSYS と Garfield⁺⁺ で ある。

⁵検出器近距離におけるホドスコープ効果や,読み出しパッド構造 の影響を考慮しているより完全な振る舞いを表現する式がこれまでに 理解されおり,性能評価のための高磁場への外挿はそちらで行う必要 がある [14]。



図 9: 円構造(左)とハニカム構造(右)をモデルに作 成された試作 GEM 型ゲートの拡大図。



図 10: 高開口率 GEM 型ゲートの断面図と TPC 端部検 出器用モジュール。

実測定を完全には再現していない。3.5 あるいは4 T で の電子透過率を推定するためには、さらなる改善が必要 な状況である。



図 11: 高開口率 (82.3 %) の GEM 型ゲートを用いた電 子透過率の測定 [12]。磁場なしではシミュレーションは 測定を再現している。1 T での評価は改善が必要な状況 である。

3 DESY での電子ビームテスト

LC-TPC グループに参加する日本の各大学,中国の IHEP 研究所の研究者を含めた日本/アジアグループは, 2016 年 10 月末から 11 月中旬まで,DESY 研究所の TPC 性能試験設備を使い,開発してきた高開口率 GEM 型ゲートが搭載された TPC 端部検出器の性能試験を行っ た。今回の実験の最大の目的は,GEM 型ゲートを搭載 した検出器であったとしても電子ドリフト距離 2.2 m で, 100 µm 以下の位置分解能が達成可能であるという証明 データを収集することである。

3.1 DESY-II 加速器



図 12: DESY-II 加速器を用いたテストビームエリアの 概略図 [15]。



図 13: TPC 性能試験設備のために超電導ソレノイドマ グネットが置かれた試験エリア。

検出器の性能試験には DESY-II 加速器からの電子 ビームを用いる (図 12)。DESY-II 加速器内には細い炭 素繊維が置かれ,電子あるいは陽電子が炭素繊維を打つ ことで制動放射により光子が生み出される。この光子を 金属標的で電子陽電子のペアにコンバートし,ダイポー ル磁石でこれらの粒子を扇形に広げ,電子をエネルギー ごとに分類する。その後コリメータでビームエリア (図 13) で使用するためのビームを選択する。DESY-II は 1 から5 GeV 程度のエネルギーの電子を供給できるが, TPC 外壁のフィールドケージなどの物質中での電子の 散乱の影響を減らすために,測定には5 GeV の高エネ ルギー電子ビームを用いる。

3.2 性能試験用検出器

性能測定には,ILD-TPC で予定されている実機サイズの装置を用いる (図 14)。端部検出器の PC ボードは扇型の構造をしている。PC ボード上部への 2 段増幅 GEM,および GEM 型ゲートを固定するため,また H.V. 供給

225





図 14: 左図上は TPC 端部検出器の読み出しパッド。右 図上は日本グループが用いいている 2 層増幅 GEM の 側面写真である。この上部に以下のような追加モジュー ルが搭載される。左図下は電場整形器が搭載された検出 器,前面および側面は電場を均一に形成するために電極 が取り付けられ,適切な電位が与えられるようになって いる。右図下は GEM 型ゲートが搭載された検出器。

ライン用のための一部のスペースを残してほぼ全面,読 み出しパッドで覆われている。パッド1枚の大きさはお およそ,幅1.2 mm縦5.26 mmであり,円筒(r)方向に 28 列, 方位角 (φ) 方向に内側 176 枚, 外側 192 枚が配置 されている。1 検出器あたり、5×10³ チャンネル程度と なる。2 段増幅 GEM の 9 mm 上部⁷には開発してきた 開口率 80 %以上の GEM 型ゲート装置が搭載される。 開口率 100 %のデータとの比較のため, GEM 型ゲート 装置の代わりに電場整形器が搭載された検出器も用意 した。増幅 GEM, GEM 型ゲートに電圧を供給するた め,H.V. ラインはGEMのアクティブエリアの近くま で伸ばす必要があるが、これは増幅 GEM 上部のドリフ ト領域の電場を歪めるので電離電子の経路を歪めるこ とになる。この状況を改善するために電場整形器を用い て滑らかな電場を再形成させる。実際のところ, GEM 型ゲートの側面にも電場整形器用の回路を形成する予定 だったが、この部分は今回のビームテストには間に合わ なかった。

3.3 読み出しエレクトロニクス

DESY に設置されている LP システムで用いる読み出 しエレクトロニクスは,ALICE-TPC [16] で用いられて いるシステム「ALTRO [17]」を基本としており,電荷 増幅,波形整形部 (PASA) を GEM 用に作り変えたもの である。上述した端部検出器の PC ボードの裏面からカ プトンケーブルが Front End Card(FEC) に接続され, この FEC 上に PASA, ALTRO チップが搭載されてい る。ALTRO チップは 20(25) MHz, 10 bit の ADC が 使用されており,ペデスタル補正,ゼロサプレッション などの機能が使用可能である。読み出しエレクトロニク スを接続し終えた状況が写真 (図 15) のようになる。エ レクトロニクスが突き出た格好のため支持構造が必要と なっているが,諸々の問題を回避するため本来 PASA, ALTRO チップは PC ボードの裏面に直接搭載されるべ きである。残念ながら改良チップの開発は遅れ気味で ある。



図 15: 検出器を TPC に組み込んだ後, 読み出しエレ クトロニクスを搭載した状態。この後さらにエレキ用に L.V. ケーブルなどが前面に搭載される。

3.4 実験準備とデータ収集

過去数回のビームテストの経験から事前準備が肝心で あることを学んでいたので, KEK 実験棟で使用予定の増 幅 GEM と GEM 型ゲートを用いて、どれだけの電圧を 供給すればどれほどのガス増幅率を得られ、どこから微 小放電が始まるか、またどの程度の電圧で最大透過率を 得られるかなどの事前測定を入念に行ってから, DESY に向かった。データ収集は10月31日より11月14日ま で、およそ2週間にわたって行った。最初の数日はLP システム含めた検出器の試運転として、ノイズ確認や検 出器の応答測定など基礎的なデータの収集を行った。そ の後、高磁場中での位置分解能の評価用に、検出器から の電子ビームの距離を変え、電離電子のドリフト距離を 変えながらデータ収集 (Z 方向スキャン) を行った。また GEM 型ゲート装置が期待するように動作しているかの 確認のため,GEM 型ゲート間にかける電圧を変えた測 定も行った。欲しいデータセットは事前にある程度決め て行ったが、ビームタイムは限られているので、最終的 には現場でデータを取りながら, 簡易解析を行い, 結果

⁷9 mm 上部というのは, ILC ビームのトレイン長で決まる。増 幅 GEM とゲート装置の間には吸収前の 2 次イオンが存在する,ト レイン長は設計上 0.73 msec 程度なので,5 mm 程度上部で十分か もしれないが,この部分は議論の余地があると思われる。



図 16: 物理解析に用いはしないが,電子が外壁でシャ ワーを起こした場合のイベント,磁場中であるので,低 エネルギー荷電粒子がカールしている様子がわかる。

3.5 幾つかのデータ解析

このニュースの原稿を書いている 12 月現在, データ 解析を始めたばかりであり, データの多くは未だ十分 に理解している状況ではない。現在得られている結果 は Preliminary なものであるが, 今回開発した GEM 型 ゲートを搭載した検出器が, 我々の期待通りに動いてい る事を表すプロット, 高磁場 3.5 T 中で到達し得ると 期待できる位置分解能を表すプロットなどを示すことに する。

3.5.1 荷電粒子に対する GEM 型ゲートの動作

検出器インストール後の1つの心配事は,GEM 型 ゲートが期待しているように動作しているかという事で ある。図 10 で示したように,開口率 82 %の GEM 型 ゲートの厚さは 25 μm 程度であり, リム幅も 30 μm 程 度であるので、文字どうりのペラペラのスカスカ状態で ある。最大限注意して扱ってはいるが、検出器のインス トール中、あるいは初めて高電圧を印加した時に、振動 や微小なチリをきっかけに GEM 型ゲートの一部が短絡 してしまう可能性がある。しかし,GEM 型ゲートは短 絡した場合でも 70 %近い透過率のため(磁場なし最大 透過85%程度と比較しても),一見に正常動作してい るのか判断しづらい。よって,GEM 型ゲートが載って いない場合の電荷量と比較することや、電荷量が確実に 変わるところまでゲートを閉じて比較する必要がある。 電荷量の比較には信号電子を増幅した後の電荷量の分布 の MPV (Most Provable Value) を用いる (図 17) 左。実 験中 GEM 型ゲートに印加していた値は 3.55 V である。

この値は小型サンプルを用いた1T中での電子透過率測 定の最大透過付近に一致し,おおよそ82%が得られる と期待できる。(図 17)右はGEM型ゲートを搭載した 検出器と電場整形器を搭載した検出器とのMPVの値の 比較である(幾つかのレイヤーの平均値)。全ドリフト 距離に対して期待する82%の減少が確認できる。位置



図 17: 全ドリフト距離に関して 2 台の検出器で取られ た MPV 値の比。

分解能式の中のパラメータ N_{eff} を用いることによって も GEM 型ゲートの動作確認は行える。 N_{eff} は生成さ れた電離電子数 N におおよそ比例するので、 N_{eff} の 比較から電子透過率を評価できる。GEM 型ゲートに印 加する電圧を変えて Z 方向スキャンを行い、位置分解 能式でフィットして N_{eff} のパラメータを見積もった結 果を図 18 に示す。図では +3.55 V のときの N および N_{eff} を 1 と規格化している。 55 Fe 線源を用いた KEK における事前測定の結果から、+3.55 V → +0.00 V の 変化で 透過率 25 % 程度の減少。+3.55 V → -3.55 V の変化で 透過率 65 % 程度の減少が期待されるが、荷 電粒子を用いて得られる結果からも同様の変化が確認で きる。



図 18: GEM 間電圧を変更した時の有効電子数 N_{eff} (赤),あるいは電離電子数 N(黒)の変化について。 磁場なしでの測定結果。

3.5.2 期待される位置分解能

今回の電子ビームテストの最大の目的は前述の通り, 「GEM 型ゲートを搭載した検出器を用いて、ドリフト 距離 2.2 m でも位置分解能 100 µm 以下が達成可能(外 挿) であることを証明するデータをとる。」ということ であった。3.5 T に外挿するために必要なパラメータは, 読み出しパッドの構造や増幅 GEM だけによる信号電荷 の広がりから決まる σ_0 ,ガスによる拡散の影響を表す C_d (3.5 T と 1.0 T), そして 測定に関与する有効電子 数 Neff である。GEM 型ゲート装置のフレーム近辺は 電場整形器が装着されておらず、形成される電場の状況 が不透明である。今回の報告において、以下に示す位置 分解能の解析には中央付近のある1レイヤーを用いたも のである(もちろん検出器境界付近のトラックの歪みな どを見る場合には、フレーム近辺のデータも意味のある ものとなる。また検出器全体の性能を考慮する場合、各 レイヤーの位置分解能の状況も見るべきである)。 中央付近のあるレイヤーに対して,信号電荷の広がりか



図 19:1 T の磁場中で測定された GEM 型ゲート搭載検 出器と電場整形器搭載検出器の位置分解能の違い。

ら見積もられた C_d はおおよそ 87, Z 方向スキャンから 得られたデータを用いて,図 19 のように位置分解能式 でフィットを行い,Z方向に沿って N_{eff} を得た。また, 1 T における C_d =87 をシミュレーションから 3.5 T に 外挿すると C_d はおおよそ 27 になる。このように求めら れた N_{eff} および C_d を用いて,1 T の条件下で測定され た位置分解能を 3.5 T に外挿すると,図 20 のようにな る。ただし, C_d はガスの状況,設定電圧により大きく変 動するので, C_d の値の詳細な評価は重要になるが,今 回は時間の都合上簡易的な評価だけを行っていることを 補足しておく。(a),(b) はそれぞれ 5 GeV 電子による結 果を外挿したものである。2 つの違いは電極パッドに対 する電荷の広がりを表す σ_{PRF} に構造と電圧設定で決ま る値を使用したか,測定値を使用したかである。5 GeV 電子の電離損失は MIP (Minimum Ionizing Particle) よ り大きく,いわゆる Fermi plateau に位置し,MIP に比 ベ多くの電離電子を発生させる。(c) は5 GeV 電子の結 果を MIP に焼き直すために N_{eff} に $1/1.4^8$ を掛けたも のである。簡易解析ではあるが,現在のところ位置分解 能は 100 μ m を下回った結果が得られている。パラメー タの評価に関してさらに解析を改善する必要があるこ とがわかっているので,信頼できる最終結果を待ちたい と思う。電場整形器が搭載された検出器との N_{eff} の値 との比較に関しては,図 19 より GEM 型ゲート検出器 で $N_{eff}=25.0$,電場整形器検出器で $N_{eff}=29.1$,変化 は 17 %程度となり,おおよそ期待する変化率が示され ている。



図 20: GEM 型ゲート搭載検出器で測定されたデータを 元に,3.5 Tに外挿した結果得られた5 GeV 電子および MIP に対する位置分解能の予想値。

4 陽イオン阻止率の評価

残る LC-TPC グループの課題の一つとしては、開発 された高開口率 GEM 型ゲート装置を用いて陽イオンに 対する透過阻止率を実測し,その性能を証明する事であ る。これまではシミュレーションを用いて阻止率を予測 してきており、-10 V 程度で O(10-4) の阻止率が陽イオ ンに対して期待されている [11]。今回, KEK 実験棟で GEM 型ゲート装置を用いて陽イオンに対する阻止率の 実測を行った。実際のところ陽イオン阻止率測定用の特 別な機器は設置されていないので、電子の阻止率より陽 イオンの阻止率の下限値を見積もることになる。前述の 通り,陽イオンは電子に比べて十分に重いため拡散の影 響が小さく、より電気力線に沿って動く事になるので、 電子の阻止率が理解できれば、陽イオンの阻止率もその 下限として得る事ができる。図 21 黒線は実際に鉄線源 やUV レーザーを用いて信号の大きさの比から電子の透 過阻止率を評価したものである。-15 V で *O*(10^{−4}) 程度

⁸1.4 という値は Heed[18] による電離損失のシミュレーションを 行って得たものである。



図 21: ゲート装置に逆電圧を印加していった場合の電 子透過率(>陽イオン阻止率が期待できる)。パラメー タはシミュレーションに用いたモデルの値。

の電子阻止率が得られている。これは例えば有効ガスゲ イン⁹が 3000 程度と仮定した場合,1個のドリフト電子 でドリフト領域中に逆流する陽イオンは1個となる。電 子の阻止率に関するシミュレーションの結果を青,赤線 で表しているが,今の所データの再現はできていない。 来年度には実際に陽イオン阻止率測定を行い,数 V の印 加で阻止率 $\mathcal{O}(10^{-4})$ の証明を行う予定である。実際は 増幅 GEM 自体にも陽イオンの吸収作用があり $\mathcal{O}(10^{-2})$ が期待できるので,ほとんど陽イオンは逆流してこない と期待される。

5 これからの研究開発

ILC-TPC のための高開口率 GEM 型ゲートの開発と しては、もちろん幾つかの追加測定や装置搭載のための 工学設計などは残っているが,企業の多大な協力もあり, ひとまず要求性能を満たす(と思われる@12月現在)装 置が完成した状況である。ILC-TPCの実現を左右する 検出器開発を行い、LC-TPC コラボレーションにおい ても重要な役割を果たしたと思う。現在 LC-TPC 内で はドイツ・フランスのグループがそれぞれのデザインに 基づいた TPC 端部検出器を開発しているが、今後どの グループも我々が開発した高開口率 GEM 型ゲートを搭 載し、性能試験を行う予定である。また ILC-TPC が実 現した場合,各グループが統合され1つの検出器をデザ インすることになると思われる。GEM 型ゲートの開発 の過程で我々が得た知見を各グループと共有し、より洗 練された検出器の開発を行っていくことが日本グループ の役割の1つであると思う。



図 22: 2016 年秋, ビームテスト参加者たち。



図 23: ビームテスト期間に行った GEM 型ゲートに関 するワークショップの記念写真。

参考文献

- https://www.linearcollider.org/ILC/Publications/Technical-Design-Report.
- [2] http://www.linearcollider.org/ILC/physicsdetectors/Detectors/Detailed-Baseline-Design.
- [3] 田辺友彦, ILC の物理, 高エネルギーニュース 32 (2014) 247.
- [4] ILC 日本グループ, ILC の検出器, 高エネルギーニュース 33 (2014) 32.
- [5] 杉山晃, 最近の TPC, 高エネルギーニュース 26 (2007) 225.
- [6] David R. Nygren, The Time-Projection Chamber, http://lss.fnal.gov/conf/C740805/p58.pdf
- [7] http://magboltz.web.cern.ch/magboltz/
- [8] RL Gluckstern, NIM A, 24, p.381-389.
- [9] S.C. Curran and J.D. Craggs,"Counting tubes, theory and applications, London: Butterworths".
- [10] F. Sauli, L. Ropelewski and P. Everaerts, NIM A 560 (2006) 269.
- P. Gros et al.,
 "Blocking positive ion backflow using a GEM gate: experiment and simulations",
 DOI:10.1088/1748-0221/8/11/C11023.
- [12] K. Ikematsu, DOI: 10.1109/NSSMIC.2014.7431237.
- [13] M. Kobayashi et al., NIM A 641 (2011) 37.
 [14] R. Yonamine et al.,
- DOI: 10.1088/1748-0221/9/03/C03002. [15] https://particle-physics.desy.de/e252106/e2522106.
- $[16] \ {\rm http://aliceinfo.cern.ch/Public/en/Chapter2/Chap2_TPC.html}.$
- [17] http://ep-ed-alice-tpc.web.cern.ch/ep-ed-alice-
- tpc/altro_chip.htm.
- [18] http://consult.cern.ch/writeup/heed/

⁹一般にアノードで測定できる分は有効ガスゲインと呼ばれ,GEM 穴でガス増幅された全電子群を絶対ガスゲインと呼ぶ。